

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005 年 8 月 11 日 (11.08.2005)

PCT

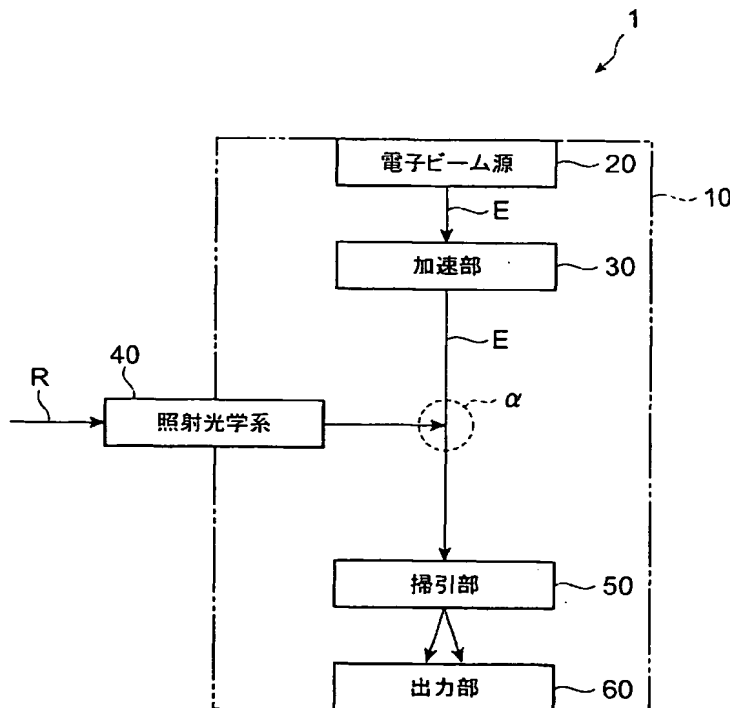
(10) 国際公開番号
WO 2005/073681 A1

- (51) 国際特許分類: G01J 1/02, H01J 31/50 (72) 発明者; および
(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/000531 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 木下 勝之 (KI-NOSHITA, Katsuyuki) [JP/JP]; 〒4358558 静岡県浜松市市野町 1 1 2 6 番地の 1 浜松ホトニクス株式会社内 Shizuoka (JP).
(22) 国際出願日: 2005 年 1 月 18 日 (18.01.2005)
(25) 国際出願の言語: 日本語 (74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外(HASEGAWA, Yoshiki et al.); 〒1040061 東京都中央区銀座一丁目 1 0 番 6 号銀座ファーストビル 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ: 特願2004-024569 2004 年 1 月 30 日 (30.01.2004) JP (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 浜松ホトニクス株式会社 (HAMAMATSU PHOTONICS K.K.) [JP/JP]; 〒4358558 静岡県浜松市市野町 1 1 2 6 番地の 1 Shizuoka (JP).

[続葉有]

(54) Title: STREAK DEVICE

(54) 発明の名称: ストリーク装置



20 ELECTRON BEAM SOURCE
30 ACCELERATION UNIT
40 IRRADIATION OPTICAL SYSTEM
50 SWEEP UNIT
60 OUTPUT UNIT

(57) Abstract: A streak device includes: a vacuum vessel (10) having an electron beam source (20) arranged at one end of the vessel (10) for outputting an electron beam E and an output unit (60) arranged at the other end of the vessel (10) for converting the electron beam into an image; an acceleration unit (30) arranged in the vacuum vessel for accelerating the electron beam; an irradiation optical system (40) for converging and applying light R to be measured to the electron beam accelerated by the acceleration unit; and a sweep unit (50) arranged between the acceleration unit and the output unit for sweeping the electron beam interacting with the light to be measured, in the direction substantially orthogonal to the displacement direction of the electron beam generated by the interaction. Thus, it is possible to realize a streak device having a high time resolution.

(57) 要約: ストリーク装置は、一端側に設けられ電子ビームEを出力する電子ビーム源20、及び、他端側に設けられ電子ビームを像に変換する出力部60を有する真空容器10と、真空容器内に設けられ電子ビームを加速する加速部30と、加速部により加速された電子ビームに被計測光Rを集光して照射する照射光学系40と、加速部と出力部との間に設けられ、被計測光と相互作用した電子ビームを、その相互作用により生じた電子ビームの変位方向に略直交する方向に掃引する掃引部50とを備える。これにより、高時間分解能化が可能なストリーク装置が実現される。



NL, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。